

S&S TECH

***“The World Best Blank Mask”
Global Leader***

(주)에스앤에스텍

2014. 08

내 용

I. 회사 소개

회사 개요

회사 연혁(인증 및 수상)

II. 제품 소개

블랭크마스크 정의 / 역할 / 사진
공급체인

III. 일반 현황

기술개발 개요
경영실적

회사 소개

■ 회사 개요

- 법인설립 : 2001. 02. 22 (주) 에스앤에스텍
- 대표이사 : 남 기수
- 생산제품 : 반도체 및 TFT-LCD 용 Blank Mask
(반도체용 - 6 인치, Display용 - 33x45 cm ~ 122x140 cm)
- 경영실적 : 매출액 - 2013년 469억원 , 영업이익 - 71억원
- 주요고객 : SEC, SK Hynix, TSMC, PKL, Toppan, Photronics, SMIC 등
- 소재지 : 대구 달서구 성서첨단산업단지
- 자본금 : 78 억원 (2009년 4월 코스닥 상장)
- 총인원 : 154명
- 특허보유 : 특허출원 225건 { 등록 80건 - 국내 58건, 해외 22건 }

회사 소개

■ 회사 연혁 : 인증

“The World Best Blank Mask” Global Leader

■ 회사 연혁 : 수상

- 2014.05 World Class300 선정
- 2013.07 대구월드스타기업 선정
 - 2011.04 히든챔피언 선정
- 2010.10 히든챔피언 선정
- 2010.07 부품소재전문기업 재인증
- 2009.08 히든챔피언 선정

- 2008.12 대한민국 10대 신기술 지정
- 2008.08 우수제조기술 연구센터(ATC) 지정



- 2005.06 신제품 인증 (NEP 인증)
- 2005.06 세계일류상품 선정(차세대)

- 2004.08 기술 혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증
- 2004.06 하이닉스 품질인증
- 2004.06 Toppan 품질인증
- 2004.03 부품소재 전문기업 인증
- 2003.09 Photronics Global 품질인증
- 2003.05 삼성전자 품질인증

- 2001.10 ISO 9001 인증
- 2001.10 PKL 품질인증

● 2001 ~ 2002

- 2001.02 에스앤에스텍 설립

● 2003 ~ 2004

- 2004.07 수출유망 중소기업 선정

● 2007 ~ 2008

- 2008.12 부품소재상 지식경제부 장관상 수상
대한민국기술대상 은상 수상

- 2008.11 '1,000 만불' 수출의 탑 수상
- 2008.10 '2008년 벤처기업 대상' 국무총리상 수상
- 2008.06 코스닥 상장 예비심사 승인
- 2007.03 대구광역시 스타기업 선정

● 2005 ~ 2006

- 2005.11 '500만불' 수출의 탑 및 산업부 장관 표창 수상
- 2005.08 제6회 중소기업 기술혁신 대전 “대통령상” 수상

● 2014

~ 2011

● 2010

● 2009

- 2013.09 전자/IT/반도체/디스플레이산업 발전 유공 대통령표창 (남 기수 대표이사)
- 2012.01 삼성전자 “신기술공모제” 선정

- 2010.11 “2,000만불 수출의 탑” 수상

- 2009.12 현재일류 상품 선정
- 2009.12 지역전략산업진흥사업 지식경제부 장관상 수상
- 2009.04 코스닥 상장

● 2005 ~ 2006

- 2005.11 '500만불' 수출의 탑 및 산업부 장관 표창 수상
- 2005.08 제6회 중소기업 기술혁신 대전 “대통령상” 수상

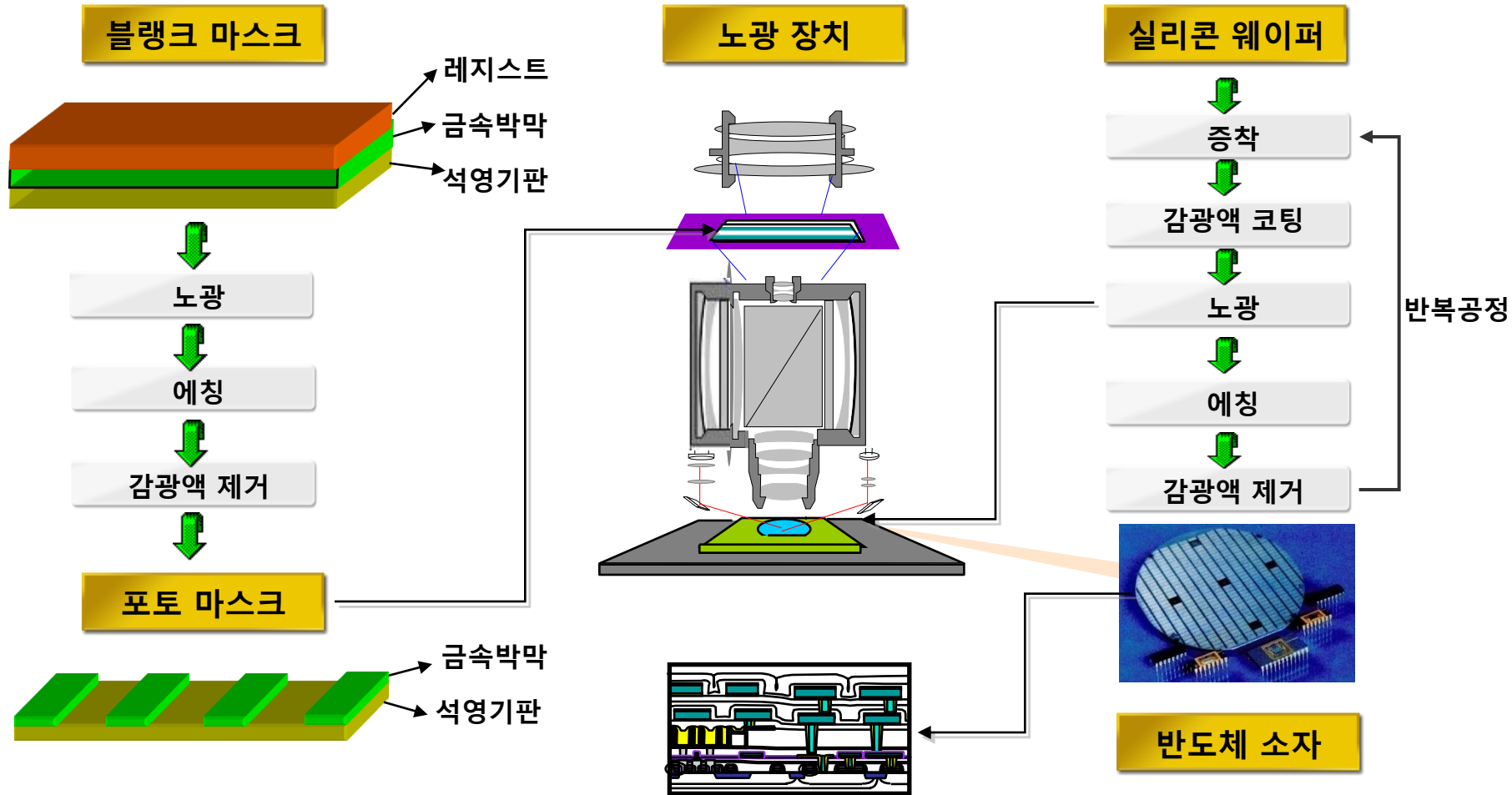


블랭크 마스크 정의

- * 반도체 및 LCD (TFT-LCD, Color Filter, OLED, LED) 제조공정에 필수적인 포토마스크의 핵심원재료
 - 블랭크마스크는 석영유리기판 위에 차광막, 반사방지막, 감광막으로 구성
- * 100% 전량 일본으로부터 수입되던 블랭크 마스크를 당사에서 2002년도에 국산화에 성공함



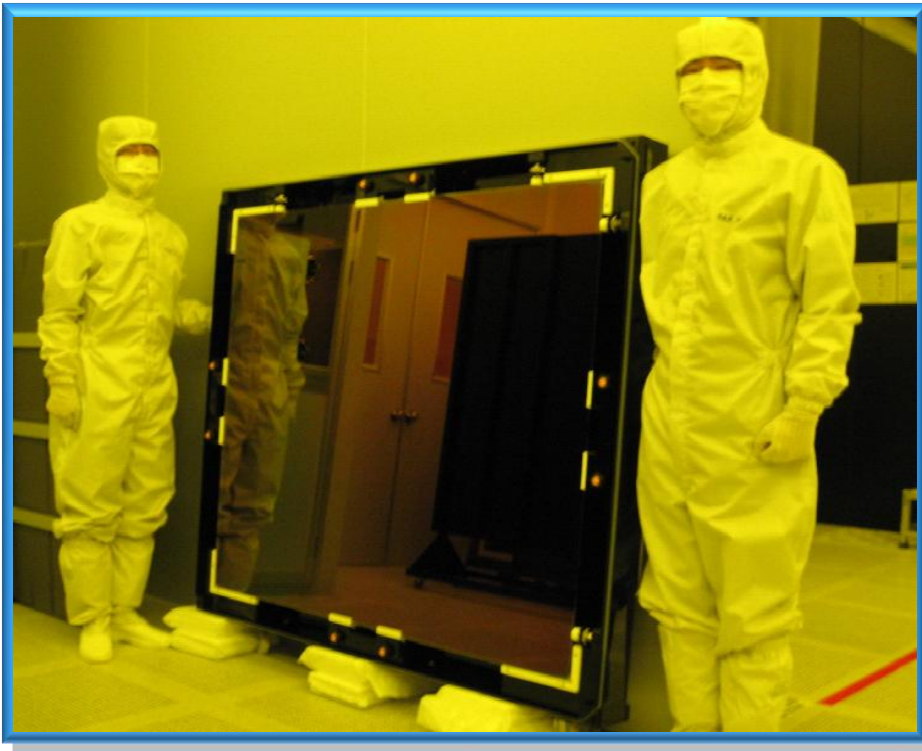
블랭크 마스크의 역할



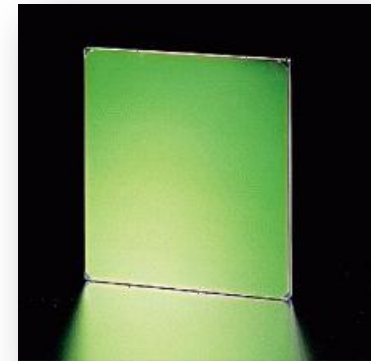
제품 소개

구분	제품사진	주요제품		
		바이너리 블랭크 마스크 (Binary Blank Mask)	위상시프트 블랭크 마스크 (Phase Shift Blank Mask)	하드마스크용 블랭크 마스크 (Hardmask Blank Mask)
반도체용 (IC용)				
구분	제품사진	바이너리 블랭크 마스크 (Binary Blank Mask)	그레이톤 블랭크 마스크 (Gray-tone Blank Mask)	위상시프트 블랭크 마스크 (Phase shift Blank Mask)
평판 디스플레이용 (FPD용)				

제품 사진



TFT-LCD용 대형 블랭크 마스크



반도체용 블랭크 마스크

공급 체인

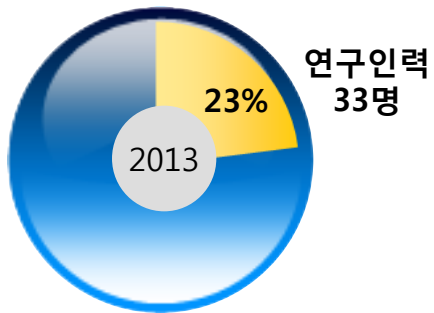
반도체용 마스크

LCD용 마스크

	반도체용 (IC)		LCD용 (FPD)
End User	삼성, 하이닉스, TSMC SMIC, Intel, IBM...	적용 제품 반도체 IC, TFT Array Color Filter	삼성, LG-Display AUO, CMO, CFI,
Photo Mask	Toppan, Photronics, DNP PKL, 삼성, 하이닉스, TSMC TMC, SMIC...	패턴형성 * Captive shop * Merchant shop	PKL, LG이노텍 (Korea) PKLT, HOYA, Finex(Taiwan) DNP, Toppan, SuperMask
Blank Mask	Hoya, Ulcoat, ShinEtsu S&S TECH	박막형성 (위상변위막, 차광막, 반사방지막, 감광층 등)	Hoya, Ulcoat, CST S&S TECH
Quartz	ShinEtsu, Tosoh Covalent, Asahi	원재료 (합성석영유리기판)	ShinEtsu, Tosoh, Covalent Nikon, KTG (Korea)

기술개발 개요

연구인력 비중

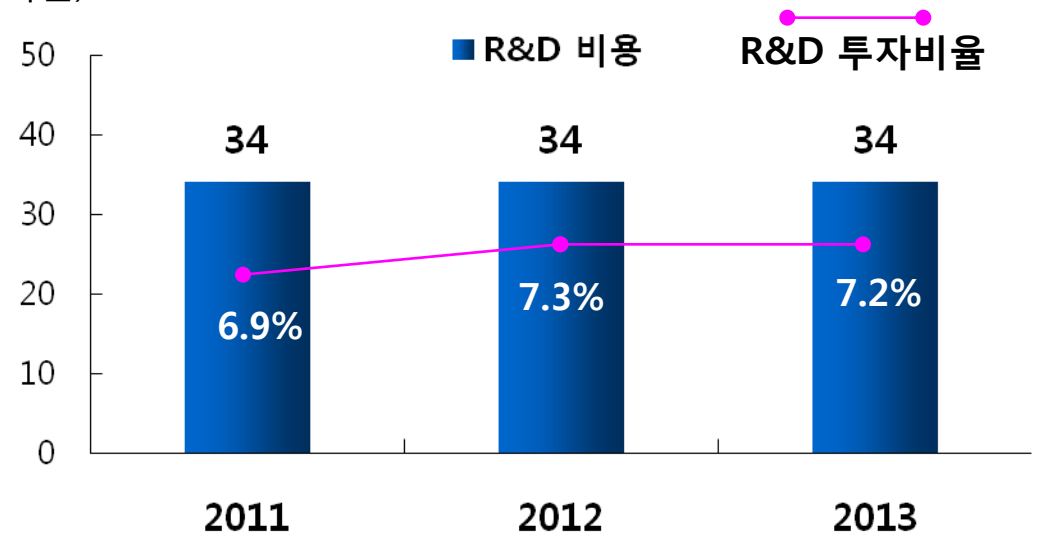


특허 보유현황

구분	출원	(등록)
국내	168	(60)
해외	45	(18)
총계	213	(78)

R&D 투자

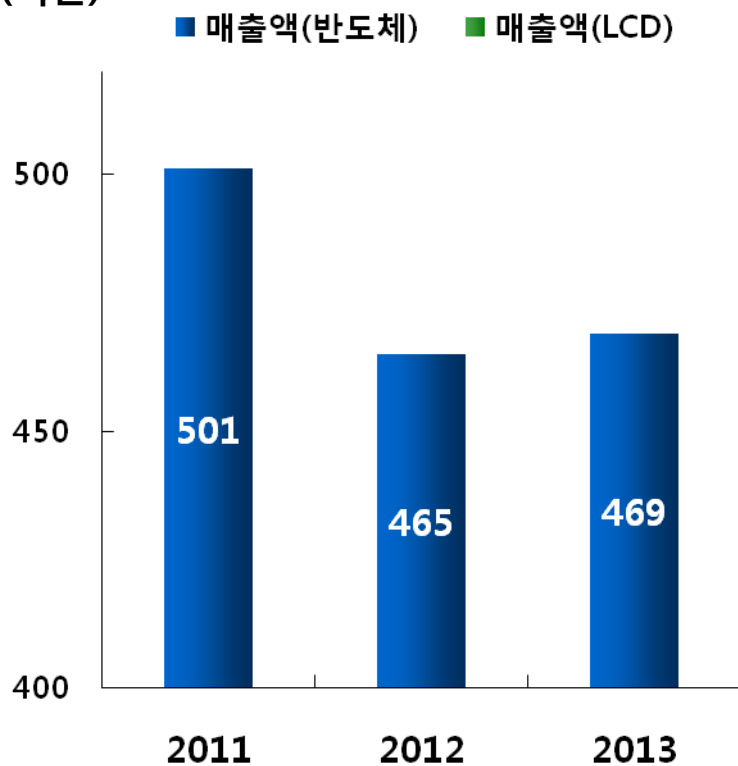
(억 원)



경영 실적

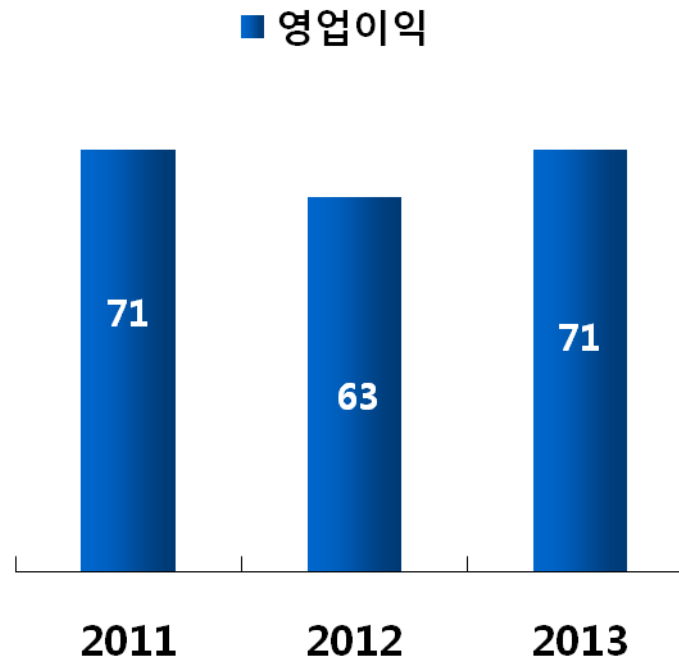
■ 성장성

(억원)



■ 수익성

(억원)



감사합니다

